

分析結果報告書[7] 共通試料1(模擬排水試料:一般項目等)
分析方法等【鉛】

鉛

の色が付いた回答欄に選択肢番号をご記入ください。
 の色が付いた回答欄に自由回答をご記入ください。
 の色が付いた回答欄に数値を半角でご記入ください。
☐ のような図形で選択肢を囲んでも結果には反映されません。

例: 1. 1未満 2. 1以上2未満 ~~3. 2以上5未満~~ 4. 5以上10未満 5. 10以上

分析主担当者

↓ 回答欄

経験年数(年)		1. 1未満 2. 1以上2未満 3. 2以上5未満 4. 5以上10未満 5. 10以上
実績(年間の分析試料数)		1. 50未満 2. 50以上100未満 3. 100以上200未満 4. 200以上500未満 5. 500以上
分析(主)担当者以外の分析結果の確認		1. あり 2. なし

分析方法等

分析開始日		○/○/○の形でご記入ください(前処理含む)
分析終了日		○/○/○の形でご記入ください
分析方法		1. フレーム原子吸光法 2. 電気加熱原子吸光法 3. ICP発光分光分析法 4. ICP質量分析法 5. その他
その他(右のセルにご記入ください)		

原子吸光度法

試験液の希釈倍率		倍(希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。)
(フレーム法)		
フレーム		1. アセチレンー空気通常炎 2. アセチレンー空気還元炎 3. アセチレンー酸化二窒素炎 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
(電気加熱法)		
注入量		μL
注入方法		1. 自動注入装置 2. 手打ち
原子化の方法		1. 黒鉛炉 2. 耐熱金属炉 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
モディファイアーの添加		1. Pdを添加 2. Pd以外の添加 3. 添加しない
Pd以外の添加(右のセルにご記入ください)		
バックグラウンド補正		1. 重水素ランプ 2. 偏光ゼーマン 3. SR補正 4. その他 5. 行わない
その他(右のセルにご記入ください)		
測定波長(nm)		nm(整数でご記入ください)

ICP発光分光分析法

ろ過等の操作		1. ろ過 2. 行わない 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
試料の希釈倍率		(希釈しない場合は「1」を記入する)
(測定装置)		
メーカー		1. アジレント 2. サーマフィッシャー 3. 島津製作所 4. パーキンエルマー 5. 日立ハイテク 6. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
発光部(光観測方式)		1. 横方向 2. 軸方向 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
分光部		1. ツェルニ・ターナー型(シーケンシャル形) 2. パッシェン・ルンゲ型(同時測定形) 3. エシェル型(同時測定形) 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
検出部		1. 光電子増倍管(フォトマル) 2. 半導体検出器 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
バックグラウンド補正		1. 行う 2. 行わない
装置メモリ低減対策		1. 酸による洗浄 2. 超純水による洗浄 3. 酸と超純水による洗浄 4. その他 5. 行わない
その他(右のセルにご記入ください)		
内標準物質		1. イットリウム 2. インジウム 3. イッテルビウム 4. その他 5. 使用しない
その他(右のセルにご記入ください)		(カタカナでお答えください)
測定時間(sec)		sec
測定波長(nm)		nm(整数でご記入ください)

ICP質量分析法

ろ過等の操作		1. ろ過 2. 行わない 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
試料の希釈倍率		(希釈しない場合は「1」を記入する)
(測定装置)		

メーカー		1. アジレント 2. サーマフィッシャー 3. 島津製作所 4. パーキンエルマー 5. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
質量分析計		1. 四重極 2. タンデム四重極(MS/MS) 3. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
スプレーチャンバーの材質		1. 石英 2. ガラス 3. 樹脂 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
超音波ネブライザーの使用		1. 使用する 2. 使用しない
装置メモリー低減対策		1. 酸による洗浄 2. 超純水による洗浄 3. 酸と超純水による洗浄 4. その他 5. 行わない
その他(右のセルにご記入ください)		
(スペクトル干渉の低減又は補正)		
コリジョン・リアクションセル		1. 行う 2. 行わない
コリジョン・リアクションセル使用ガスの種類		1. ヘリウム 2. 水素 3. ヘリウム・水素混合ガス 4. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
コリジョン・リアクションセル使用ガスの流量 (mL/min)		(mL/min)
補正式による補正		1. 行う 2. 行わない
その他の方法		1. 行う 2. 行わない
内標準物質		1. タリウム 2. ビスマス 3. インジウム 4. イットリウム 5. レニウム 6. ロジウ ム 7. その他 8. 使用しない
その他(右のセルにご記入ください)		(カタカナでお答えください)
積分時間(質量数毎)(sec)		sec
質量数(m/z)		(整数でご記入ください)

標準液

メーカー名		1. 富士フイルム和光純薬 2. 関東化学 3. SPEX 4. スペルコ 5. GLサイエンス 6. SCP 7. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
使用時の濃度保証		1. 保証期間内 2. 保証期間超過

定量方法

定量方法		1. 絶対検量線法 2. 標準添加法 3. 内標準法
検量線作成点数		
検量線最高濃度応答値		(吸光度、信号強度等(濃度ではない)。複数測定の場合は平均値。)
空試験応答値		(同上(濃度ではない)、標準添加法では記入しない。 複数測定の場合は平均値。)
試料応答値		(同上(濃度ではない)、 3回の平均値。)

下限値等

装置検出下限値(LOD) (mg/L)		mg/L (試料中の濃度を示す)
LOD算出方法		1. JIS K 0121(原子吸光分析通則)附属書に記載されている方法 2. JIS K 0116(発光分 光分析通則)に記載されている方法 3. JIS K 0133(高周波プラズマ質量分析通則)に記 載されている方法 4. 3σ法で計算 5. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
LOD-σ の算出: 繰り返し測定濃度 (mg/L)		mg/L
LOD-σ の算出: 繰り返し測定回数 (回)		回
分析法定量下限値(MLOQ) (mg/L)		mg/L (試料中の濃度を示す)
MLOQ算出方法 (JIS K 0133ではLOQ)		1. JIS K 0121(原子吸光分析通則)附属書に記載されている方法 2. JIS K 0116(発光分 光分析通則)に記載されている方法 3. JIS K 0133(高周波プラズマ質量分析通則)に記 載されている方法 4. 10σ法で計算 5. その他
その他(右のセルにご記入ください)		
MLOQ-σ の算出: 繰り返し測定濃度 (mg/L)		mg/L (試料中の濃度を示す)
MLOQ-σ の算出: 繰り返し測定回数 (回)		回

分析実施にあたっての留意した点及び 問題と感じた点	
計算式	鉛濃度(mg/L)=